

謝辞の記載 をお願いいたします

本事業の成果・アクティビティ評価は、皆様の成果物の蓄積によって支えられております。

皆様には以下の点をご協力いただけますようお願い申し上げます。

1. 機器利用、技術補助、技術代行、共同研究、技術相談の利用形態に関わらず、ARIM事業利用者は、論文などへ謝辞を必ず入れてください。
2. ARIM事業利用から数年経っていても、利用結果が寄与する論文発表や特許、プレス発表などを実施した場合は、必ず、ご連絡ください。
3. 論文発表の謝辞には以下の様に体系的課題番号の記載をお願いします。

JPMXP12(固定)＋西暦年度下二桁＋実施機関コード(AT)＋5(ANCF)＋課題番号(3桁)

(ARIM課題番号は課題ごとに内諾書または回答書発行の際に割り当てられます。未提出や不明の場合はANCF事務局にお尋ね下さい。)

例 2025年度ANCFの000の場合 体系的課題番号JPMXP1225AT5000 ※常に15桁になります。

謝 辞 (例)

謝辞例 1 一般

【和文】

本研究(の一部)は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」事業(課題番号 JPMXP1225AT5000)の支援を受けた。

【英文】

(A part of) This work was supported by “Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan (ARIM)” of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). Proposal Number JPMXP1225AT5000.

謝辞例 2 特に支援者の貢献が大きかった場合には支援者の貢献がわかるような記載をお願いいたします。

【和文】

本研究(の一部)は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」事業課題として産業技術総合研究所先端ナノ計測施設(ANCF)の支援(課題番号 JPMXP1225AT5000)を受けて実施された。ANCFのAA氏の〇〇測定には深く感謝する。

【英文】

(A part of) This work was supported by “Advanced Research Infrastructure for Materials and Nanotechnology in Japan (ARIM)” of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT). Proposal Number JPMXP1225AT5000. We are grateful to Mr. AA in AIST Nanocharacterization Facility (ANCF) for measurements of _____.

重要技術領域 量子・電子制御により革新的な機能を発現するマテリアル

実施機関 (スポーク機関)

*センターハブ機関

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

国立研究開発法人 物質・材料研究機構

先端ナノ計測施設（ANCF）事務局

マテリアル先端リサーチインフラセンターハブ事務局

E-mail : ancf-contact-ml@aist.go.jp

E-mail : ARIM_info@nanonet.go.jp

<https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html>

<https://www.nanonet.go.jp/arim/>